# Základy technologie

# fotonických vlnovodných struktur



## Některé významnější technologie

```
Iontová výměna ve skleněných podložkách (ion exchange – difúzní proces)
      Pasivní, případně aktivní struktury (dopované Er<sup>3+</sup>)
Polymery (odstředivé nanášení)
      Termooptické (elektrooptické?) modulátory a přepínače
Ti:LiNbO<sub>3</sub>, APE LiNbO<sub>3</sub> (difúzní procesy)
      Elektrooptické, akustooptické, aktivní (dotované Er<sup>3+</sup>),
      nelineární optické prvky (kaskádní procesy \chi^2: \chi^2)
Silica on silicon (Si/SiO<sub>2</sub>/SiO<sub>2</sub>:Ge,P/SiO<sub>2</sub>)
       hydrolýza plamenem (IO "vlákno")
       Měrný útlum řádu 0.001 dB/cm
       Pasivní součástky, termooptické, aktivní (dotované Er<sup>3+</sup>)
Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> on silica (Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> /SiO<sub>2</sub>/Si) (chemické depozice - PECVD);
       Pasivní součástky, termooptické, aktivní (dotované Er<sup>3+</sup>)
Polovodiče III-V (InP/Ga<sub>x</sub>In<sub>y</sub>As<sub>1-x</sub>P<sub>1-y</sub>, GaAs/Al<sub>x</sub>Ga<sub>1-x</sub>As) – epitaxní růst
      MOCVD, MBE, CBE
      Lasery, polovodičové zesilovače, elektroabsorpční
      modulátory, spektrální de/multiplexory, detektory,...)
Silicon on Insulator (SOI, Si/SiO<sub>2</sub>/Si)
       ("wafer bonding", extrémní kontrast indexu lomu 3.5 : 1.5,
       velmi malá stopa vidu, extrémní hustota součástek)
Lithium Niobate on Insulator (LNOI, LiNbO<sub>3</sub>/SiO<sub>2</sub>/Si)
      ("wafer bonding"); velký kontrast indexu lomu 2.2 : 1.5
      menší stopa pole vidu, vysoká účinnost elektrooptických součástek
```

## Příprava vlnovodů v LiNbO3 difúzními metodami

Difuze titanu

Protonová výměna



Příprava polovodičových vlnovodů A<sup>III</sup>B<sup>V</sup> epitaxním růstem





## Příprava vlnovodů SOI (silicon on insulator)



## Lithium niobate on insulator – technologie přípravy



**FIG. 1.** Fabrication sequence of lithium-niobate-on-insulator thin films by combining ion cut and wafer bonding: (a) preparation of ion-implanted donor wafer and (b) SiO<sub>2</sub>-deposited acceptor wafer, (c) wafer bonding, (d) thermal treatment. (e) The final high-quality lithium-niobate-on-insulator thin film after a fine surface polishing process.

Y. Jia, L. Wang, and F. Chena, Appl. Phys. Rev. 8, 011307 (2021)



## Příprava vlnovodů LNOI (lithium niobate on insulator)







## Příprava masek na elektronovém litografu

- 1. Modelování a návrh struktury vlnovodů a elektrod
- 2. Příprava dat pro elektronový litograf (digitalizace?)
- 3. Skleněná (křemenná) podložka s cca 50-100 nm Cr ("matný chrom")
- 4. Depozice elektronového rezistu odstředivkou (roztok PMMA)
- 5. Expozice rezistu elektronovým svazkem
- 6. "Vyvolání" fotorezistu (odstranění exponovaných míst)
- 7. lontové leptání chromové vrstvy

# Pasivní fotonické vlnovodné struktury



## Vlnovodné rozvětvení 1×2

1. Jednovidové rozvětvení buzené do společné větve



Výkon se dělí rovnoměrně do obou výstupních větví z důvodů symetrie

#### Symetrické rozvětvení buzené v opačném směru

 $\Delta \varphi$ 

2. Současné buzení do obou větví se vzájemným fázovým posuvem



Relativní změnou fáze vidů ve vstupní větvi je možno měnit výstupní výkon



## Symetrická směrová odbočnice (směrový vazební člen)



## Spektrální vlastnosti směrové odbočnice

UFE



Rozložení optického záření

#### Asymetrické vlnovodné rozvětvení jako oddělovač vidů



 $\frac{\Delta N_{eff}}{\sqrt{n_s^i - N_{eff}^2} \theta} \begin{cases} >1, \Rightarrow \text{ asymetrické Y, oddělovač vidů} \\ <0.1, \Rightarrow \text{ symetrické Y, dělič výkonu} \end{cases}$ 

Pokud je výstupní úhel  $\theta$  velmi malý ( $\theta < 0,2^{\circ}$ ) a výstupní větve asymetrické, chová se rozvětvení Y jako *oddělovač vidů*, nikoli jako dělič výkonu

#### Spektrálně nezávislá odbočnice 2×2



Odbočnice může pracovat v celém intervalu 1,25 – 1,6 µm; omezení je dáno oblastí jednovidového režimu vlnovodů



Odbočnice může pracovat v celém intervalu 1,25 – 1,6 µm; omezení je dáno oblastí jednovidového režimu vlnovodů

## Děliče s mnohovidovou interferencí

Elementární teorie kovového dvoudeskového vlnovodu



nedokonalé zobrazení

# Děliče s mnohovidovou interferencí

Princip: Interference vidů v mnohovidovém planárním vlnovodu (~1978)



#### Úprava pro zmenšení fázové chyby (snížení počtu potřebných vidů)

původní tvar



modifikovaný tvar



struktura děliče 2×2 včetně vstupních a výstupních vlnovodů



M.T.Hill, J. Lightwave Technol. 21, 2305-2313, 2003

# Vazební člen 2x2 s úpravou pro zmenšení fázové chyby (snížení počtu potřebných vidů) a redukcí ztrát v ohybech



M.T.Hill, J. Lightwave Technol. 21, 2305-2313, 2003

struktura děliče 2×2 včetně vstupních a výstupních vlnovodů



#### Hvězdicový difrakční vazební člen M×N



"Jalové" vlnovody pro zlepšení rovnoměrnosti rozdělení výkonu

UFE

Umožňuje rovnoměrně navázat záření do velkého počtu (až několika desítek) vlnovodů

#### Spektrální demultiplexor s fázovanou řadou vlnovodů ("Phasar", AWG – arrayed waveguide grating demux)

Fázovaná řada (několika desítek) vlnovodů



M. K. Smit, 1987; dnes asi nejpopulárnější součástka



#### Příklad provedení integrovaně-optického AWG demultiplexoru na bázi InP



 $\Delta \lambda = \frac{\lambda}{f} \Delta f = \frac{\lambda^2}{c} \Delta f; \text{ pro } \lambda = 1550 \text{ nm a } \Delta f = 100 \text{ GHz je } \Delta \lambda = 0.8 \text{ nm}$ 

#### Příklady AWG demultiplexorů - 1

#### SOI, Institute of Microstructural Sciences, NRC, Ottawa, 2004





### Příklady AWG demultiplexorů - 2



UFE



#### 4 kanály, InP podložka

COBRA TU/e, NL: Y. Barbarin et al. *IEEE Photon. Technol. Lett.*, Vol. 16, pp 2478-80, Nov. 2004.



#### 17 kanálů, SOI

T. Fukazawa et al. *Jpn. J. Appl. Phys*., Vol. 43 No. 5B, pp. 673–675, 2004

# AWG

- 16-channel AWG, 200GHz
- 200µm x 500µm area
  - -3dB insertion loss
  - -15dB to -20dB crosstalk





<sup>100</sup>µm

### Machův-Zehnderův filtr 11. řádu

- Channel drop, 1 out of 8
- $\Delta f_{ch} = 200 GHz$
- 11th order filter
- -15dB crosstalk







Dynamické a nelineární fotonické vlnovodné prvky

#### Poruchová metoda výpočtu konstanty šíření "slabě modifikovaného" vlnovodu

Zjednodušená rovnice "vázaných vln zanedbávající zpětné vlny:

$$\frac{da_{\mu}(z)}{dz} = i\beta_{\mu}a_{\mu}(z) + i\sum_{\nu} K_{\mu\nu}^{++}(z)a_{\nu}(z).$$

Pro slabou homogenní poruchu (nezávislou na z) přibližně platí

$$\begin{split} &\frac{da_{\mu}\left(z\right)}{dz}\approx i\beta_{\mu}a_{\mu}\left(z\right)+i\mathcal{K}_{\mu\mu}^{++}a_{\mu}\left(z\right), \quad \text{neboli} \quad \frac{da_{\mu}\left(z\right)}{dz}\approx i\left(\beta_{\mu}+\mathcal{K}_{\mu\mu}^{++}\right)a_{\mu}\left(z\right), \quad \text{a}\\ &a_{\mu}\left(z_{0}+\Delta z\right)\approx \exp\left[i\left(\beta_{\mu}+\mathcal{K}_{\mu\mu}^{++}\right)\Delta z\right]a_{\mu}\left(z_{0}\right). \end{split}$$

"Porucha" tedy (v prvním přiblížení) způsobí změnu konstanty šíření o hodnotu

$$\Delta\beta = \frac{\omega\varepsilon_0}{4} \frac{\left|\beta_{\mu}\right|}{\beta_{\mu}} \iint\limits_{S} \left[\varepsilon\left(x,y\right) - \varepsilon^{\left(0\right)}\left(x,y\right)\right] \left(\left|\mathbf{e}_{\mu\perp}^*\left(x,y\right)\right|^2 + \frac{\varepsilon^{\left(0\right)}\left(x,y\right)}{\varepsilon\left(x,y\right)} \left|\boldsymbol{e}_{\mu\boldsymbol{z}}\right|^2\right) dxdy.$$



#### Termooptický jev



Jednoduchý jev – existuje ve všech materiálech
 při vhodné konstrukci časové konstanty řádu ms až µs!

 $\varphi = k_0 NL$ 

fázový posun

při šíření vlny

Elektrooptický jev

změna indexu lomu (tenzoru optické permitivity) vlivem vnějšího elektrického pole

$$\Delta(\boldsymbol{\varepsilon}^{-1}) = \tilde{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{E}_{\boldsymbol{v}}; \quad \Delta \boldsymbol{\varepsilon} \cong -\boldsymbol{\varepsilon} \cdot (\tilde{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{E}_{\boldsymbol{v}}) \cdot \boldsymbol{\varepsilon}$$

malá změna permitivity  $\Rightarrow$  teorie vázaných vln





#### Akustooptický jev

difrakce na (povrchové) akustické vlně jako na dynamické optické difrakční mřížce



Nekolineární interakce:

#### Akustooptický jev

#### Kolineární interakce



Účinnost akustooptické interakce

$$\eta = \frac{\kappa^2}{\kappa^2 + (\Delta k_z / 2)^2} \sin^2 \left( \sqrt{\kappa^2 + (\Delta k_z / 2)^2} L \right),$$
$$\kappa \approx \frac{k_0}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} e^{TM} \left( x, y \right) \cdot \Delta \varepsilon \left( x, y \right) \cdot e^{TE} \left( x, y \right) dxdy = \frac{\pi}{2L_c}$$



#### Účinnost akustooptické interakce

$$\eta = \frac{\kappa^2}{\kappa^2 + (\Delta k_z / 2)^2} \sin^2 \left( \sqrt{\kappa^2 + (\Delta k_z / 2)^2} L \right),$$



# Vliv koncentrace volných nosi**čů** náboje na optické vlastnosti polovodičového materiálu "Volné" elektrony ve vodivostním pásu v homogenním elektrickém poli $m_e^* \frac{d^2 x}{dt^2} + \gamma \frac{dx}{dt} - qE_0 e^{-i\omega t} = 0$ , $\gamma$ – fenomenologická konstanta tlumení Ustálené řešení je $X_0 = \frac{q}{m_e^* \omega^2 + i\gamma\omega} E_0$ – amplituda výchylky z rovnovážné polohy Elektrická polarizace: $\Delta P = -qn_e x_0 = -\frac{q^2 n_e}{m_e^* \omega^2 + i\gamma\omega} E_0$ $n_e$ – koncentrace elektronů $\Delta \varepsilon = \Delta P / (\varepsilon_0 E_0) = -\frac{q^2 n_e}{\varepsilon_0 (m_e^* \omega^2 + i\gamma \omega)} \approx -\frac{q^2 n_e}{\varepsilon_0 m_e^* \omega^2} + i \frac{q^2 n_e \gamma}{\varepsilon_0 (m_e^*)^2 \omega^3}$ V konstantním poli $\gamma \frac{dx}{dt} = qE$ , $t.j. v = \frac{dx}{dt} = \frac{q}{\gamma}E = \mu_e E$ , $\mu_e$ – pohyblivost elektronu $\varepsilon + \Delta \varepsilon = (n + \Delta n)^2 \doteq \varepsilon + 2n\Delta n + (\Delta n)^2$ $\Delta n' \approx -\frac{q^2 n_e \lambda^2}{8\pi^2 \varepsilon_0 n m_e^* c^2}, \quad \alpha = k_0 \Delta n'' \approx \frac{q^3 n_e \lambda^2}{8\pi^2 \varepsilon_0 n m_e^{*2} \mu_e c^2}$ pak $\Delta n' \simeq 10^{-3} \div 10^{-2}$ (!), $b \approx 1 \text{ dB/cm}$

#### Elektroabsorpce a elektrorefrakce v polovodičích

Zakázaný pás

 $\downarrow$ 



"Zesílení" excitonovými efekty v kvantových jamách; QCSE (Starkův jev v kvantově ohraničených strukturách)

## Starkův jev v kvantově ohraničených strukturách (QCSE)





UFE

Pásový energetický diagram polovodiče s kvantovou jámou s přiloženým napětím (el. polem) E Vodivostní pás Vodivostní pás Valenční pás

Elektroabsorpční Starkův jev (QCSE)  $\Rightarrow$ Kramersovy-Kronigovy relace  $\Rightarrow$ Elektrorefrakční Starkův jev (QCSE)

Excitonové jevy v kvantových jamách zvýrazňují QCSE (strmější absorpční hrana)

#### Machův-Zehnderův interferometrický modulátor



#### Modulační rychlost elektrooptických modulátorů l

Standardní modulátor s elektrodami "se soustředěnými parametry"



#### Modulační rychlost elektrooptických modulátorů II

Modulátor s elektrodami s postupnou vlnou

 $N_{\mu} \approx 4.2$ ,  $N \approx 2.2$ 



Účinnost modulace elektrodami délky *L*:

Šířka pásma (pro pokles účinnosti modulace o 4 dB) je

Pro

$$B \cdot L pprox rac{\Omega_{\max}}{2\pi} L = rac{c}{2(N_{\mu} - N)}$$

UFE

Elektrody tvoří součást mikrovlnného koplanárního vedení ⇒ neuplatní se kapacita elektrod, kritický je *rozdíl rychlostí šíření optické a modulační elektrické vlny*.

Optická vlna:

$$E_{opt} = E_0 \exp[j\omega(t - Nz/c)]$$

$$\eta_{\rm mod} \sim \left[ \frac{\sin \frac{\Omega}{2c} \left( N_{\mu} - N \right) L}{\frac{\Omega}{2c} \left( N_{\mu} - N \right) L} \right]^2;$$

$$B \cdot L \approx 10 \text{ GHz} \cdot \text{cm}$$

#### Technické parametry reálných elektrooptických modulátorů



Typická modulační charakteristika

"Offset" v přepínací charakteristice je důsledkem rozdílu v optické dráze ramen interferometru. Je ho možno kompenzovat napětím. U rychlých modulátorů se proto vytváří sada kompenzačních elektrod.

$$\frac{P_{out}}{P_{in}} = \frac{1}{2} \left[ 1 + m \cos\left(\pi \frac{U - U_0}{U_{\pi}}\right) \right], \quad m < 1$$

Spínací poměr (extinkce, extinkční poměr)

$$E = 10\log\frac{P_{\max}}{P_{\min}} = 10\log\frac{1+m}{1-m}$$

Vložný útlum

$$L = 10 \log \frac{P_{in, fibre}}{P_{max, fibre}}$$

U kvalitních modulátorů  $E \ge 20 \text{ dB}, IL \le 3 \text{ dB}$ 

# Elektroopticky řízený Machův-Zehnderův interferometrický modulátor s postupnou vlnou



#### Komerční elektrooptické modulátory



**Frequency Response** 







#### 100 GHz LiNbO<sub>3</sub> modulátor s ovládacím napětím 5,1 V



#### Modulátor využívající inverzi domén v LiNbO<sub>3</sub>

Zjednodušení elektrodové struktury:





UFE

Valerio Pruneri et al., Avanex Corporation, Italy ICFO, Spain ICREA, Spain, 2007

## Modulátor pro kvadraturní fázovou modulaci (QPSK)

Imaginary axis

Modulační formát přenášející 2 bity/symbol



Realizace v LiNbO<sub>3</sub>





Machův-Zehnderův interferometrický přepínač/modulátor v polovodičovém materiálu (InP/InGaAsP), elektrorefraktivní modulace











#### Elektrooptické vlnovodné přepínače

Elektroopticky řízená směrová odbočnice 2 nebo více sekcí opačně napájených "Δβ – reversal" Nízké ovládací napětí, komplikovaná spínací charakteristika, napětím lze korigovat tolerance paramertrů

Přepínač s dvouvidovou interferencí "two-mode interference coupler"

Nízké ovládací napětí, sinusová spínací charakteristika

Střední část vlnovodné struktury je dvouvidová. Symetrický vid má ve štěrbině mezi elektrodami maximum, antisymetrický vid minimum  $\Rightarrow$  vidy jsou ovlivňovány různě. Tím dojde k *fázovému posuvu* mezi nimi  $\Rightarrow$  *přepínání.* Oba tyto elektrooptické přepínače jsou **polarizačně závislé**.





## Polarizačně nezávislý "digitální" optický přepínač (DOS) v LiNbO3





#### "Layout" optických vlnovodů a elektrodové struktury přepínače



#### Příprava EO modulátoru využívající technologii LNOI



Hromadná výroba elektrooptických přepínačů a dalších komponent využívající technologii "Lithium Niobate on Insulator" (LNOI) a DUV litografii



Optics Express Vol. 28, No. 17, 24452 (2020)

#### SEM obrázek části modulátoru



Optické spektrum signálu modulovaného frekvení 110 GHz



# Počet přepínačů 1×2 ("DOS") potřebný pro realizaci přepínací matice N×N s "neblokující architekturou"

	N	Number of 1×2's
R&D R&D	2	4
/ailabi Fabr	4	24
ially ially	8	112
	16	480
	32	1984
	64	8064
	128	32,512
	256	130,560
$\left( \right)$	512	523,264
V	1024	2,095,104

### Vlnovodné optické zesilovače a lasery (EDWA, EDWL)



Vlnovody z různých materiálů: (fosfátové) sklo,  $Al_2O_3$ , LiNb $O_3$ , ... zesílení  $\approx 10 \text{ dB}$ 

Výhody: malé rozměry, možnost současného zesilování signálů na různých "nosných" vlnových délkách možnost integrace s pasivními součástkami na jednom čipu ("zero-dB splitter")

Nevýhody: malá délka -> vysoká koncentrace dopantů, malé zesílení

#### Vlnovodný optický zesilovač dopovaný erbiem

Substrátové sklo a iontová výměna: VŠCHT, litografie a charakterizace: ÚFE





#### Vlnovodný optický zesilovač dopovaný erbiem

Substrátové sklo a iontová výměna: VŠCHT, litografie a charakterizace: ÚFE

Waveguide parameters	<b>K</b> <sup>+</sup>	$Ag^+$
Mode-field dimensions	9.6×12.9 μm	6.1×7.0 μm
Mode-field dimensions @ 980 nm	6.9×10.5 μm	3.2×4.8 μm
Scattering loss @ 1550 nm	0.18 dB/cm	0.85 dB/cm





#### Vlnovodný zesilovač Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>: Er<sup>3+</sup> na Si/SiO<sub>2</sub> podložce

spirála 1×1 mm<sup>2</sup> zisk 2,3 dB na  $\lambda$  = 1,55 µm při čerpání 10 mW na 1,48 µm



M.K. Smit et al. (TUD); Appl. Phys. Lett. 68, 1888 (1996)



# Vlnovodný Ti:Er:LiNbO3 laser s integrovaným elektrooptickým modulátorem pro synchronizací vidů



Ultrakrátké pulsy (≤ 5 ps), opakovací frekvence ≈ 20 GHz

(Univerzita Paderborn, D, 1997-2000)



Polarizačně nezávislý akustoopticky laditelný začleňovací/vydělovací demultiplexor v LiNbO<sub>3</sub>

Princip: kolineární AO TE-TM konverze



Střední vlnová délka  $\lambda_c = 1,55 \ \mu m$ , vzdálenost kanálů < 1 nm, přeladitelnost  $\Delta \lambda \approx 70 \ nm$ 



#### Add-drop multiplexer s kaskádním řazením filtrů a kompenzací frekvenčního posuvu



(Univerzita Paderborn 1997-2000)

#### Kódov**ě** transparentní konverze vlnových délek pro optické komunika**č**ní systémy

Nelineární optický jev 2. řádu – generování rozdílové frekvence



$$K = 2\pi / \Lambda;$$
  $k_c = k_p - k_s + K;$ 

Probném: vlnovod je na  $\omega_p \approx 2\omega_s$  dvou- až třívidový  $\Rightarrow$  obtížná excitace základního vidu.

Řešení: kaskádní aplikace dvou procesů

UFE

$$\chi^{(2)}$$

### Kódov**ě** transparentní konverze vlnových délek pro optické komunika**č**ní systémy

Kaskáda dvou nelineárních třívlnových procesů ( $\chi^2$ :  $\chi^2$ ) v PPLN



#### Princip

- 1. generování 2. harmonické
- 2. generování rozdílové frekvence

$$K = 2\pi / \Lambda; \qquad k_{2p} = 2k_p + K;$$

$$k_c = k_{2p} - k_s - K = 2k_p - k_s \approx k_s$$

Aplikační možnosti

- Konverze vlnové délky
- Kompenzace disperze (inverze frekvenční závislosti!)
- Optické vzorkování rychlých průběhů



$$\omega_{c} = 2\omega_{p} - \omega_{s},$$
$$\omega_{c} = \omega_{p} - (\omega_{s} - \omega_{p})$$

## Konec části 3

